

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. März 2022 (24.03.2022)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2022/057978 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C23C 16/458 (2006.01) H01J 37/32 (2006.01)
C23C 16/509 (2006.01) H01L 21/67 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2021/100759

(22) Internationales Anmeldedatum:
14. September 2021 (14.09.2021)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2020 124 030.9
15. September 2020 (15.09.2020) DE

(71) Anmelder: **CENTROTHERM INTERNATIONAL AG**
[DE/DE]; Württemberger Str. 31, 89143 Blaubeuren (DE).

(72) Erfinder: **TRÖLLER, Mirko**; centrotherm international AG, Württemberger Str. 31, 89143 Blaubeuren (DE). **FUCHS, Jens-Uwe**; centrotherm international AG, Württemberger Str. 31, 89143 Blaubeuren (DE). **REIZE, Ralf**; centrotherm international AG, Württemberger Str. 31, 89143 Blaubeuren (DE). **LEICHTLE, Roland**; centrotherm international AG, Württemberger Str. 31, 89143 Blaubeuren (DE).

(74) Anwalt: **HEYERHOFF GEIGER & PARTNER PATENTANWÄLTE PARTGMBB**; Heiligenbreite 52, 88662 Überlingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,

(54) Title: DEVICE, SYSTEM AND METHOD FOR PLASMA-ENHANCED CHEMICAL VAPOR DEPOSITION

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG, SYSTEM UND VERFAHREN ZUR PLASMAUNTERSTÜTZTEN CHEMISCHEN GASPHASENABSCHEIDUNG

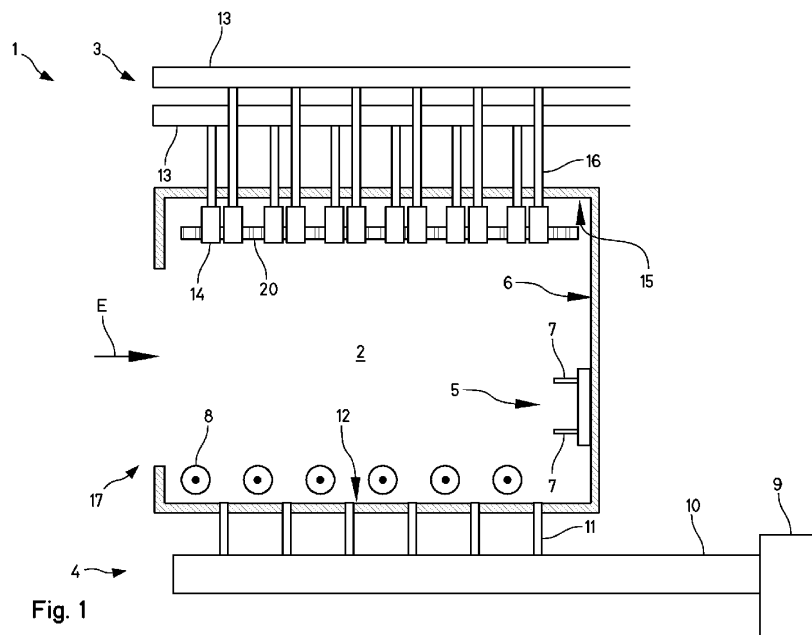


Fig. 1

(57) Abstract: The present invention relates to a device (1), a system (50) and a method (100) for plasma-enhanced chemical vapor deposition. A process chamber (2) is configured to receive at least one workpiece carrier (30). According to the invention, the device (1) is configured to heat the process chamber (2) with the aid of at least one workpiece carrier (30) that can be received by the process chamber (2).

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1), ein System (50) und ein Verfahren (100) zur plasmaunterstützten chemischen Gasphasenabscheidung. Dabei ist eine Prozesskammer (2) zur Aufnahme wenigstens eines Werkstückträgers (30) eingerichtet. Erfindungsgemäß ist die Vorrichtung (1) dazu eingerichtet, die Prozesskammer (2) mithilfe wenigstens eines von der Prozesskammer (2) aufnehmbaren Werkstückträgers (30) zu beheizen.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2022/057978 A1

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA,
MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)